

**FAX – ANTWORT**

**030 | 63 92 17 29**

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Fokusseminar  
>> Dünnschichtmesstechnik << an.

Anmeldungen sind bis zum 24.03.2009 per Fax oder per  
E-Mail an optecbb@optecbb.de möglich.

Infos: OpTecBB, Telefon: 030 / 6392 1720  
E-Mail: optecbb@optecbb.de

Ort: Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie  
GmbH, Elektronenspeicherring BESSY II  
Albert-Einstein-Straße 15  
12489 Berlin

Tagungsgebühr:

Mitglieder von OpTecBB 50,00 EUR\*

Nichtmitglieder: 100,00 EUR\*

\*) zuzüglich 19% MwSt.

\_\_\_\_\_  
Titel, Vorname, Name

\_\_\_\_\_  
Firma / Institution

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

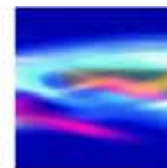
\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

OpTecBB wird gefördert von:

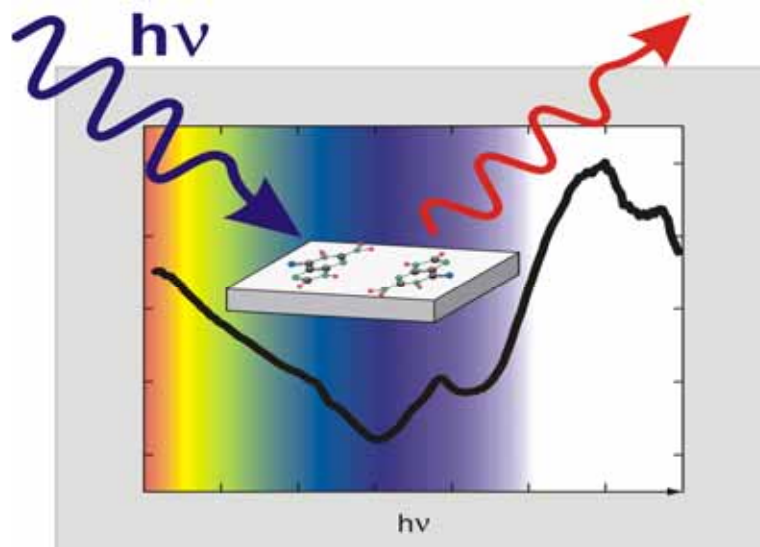


**OpTecBB**



## Schwerpunkt Optische Prozessmesstechnik

### Fokusseminar >>Dünnschichtmesstechnik<<



**Dienstag, 31. März 2009**

09:30 – 15:30 Uhr

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und  
Energie GmbH,  
Elektronenspeicherring BESSY II  
Albert-Einstein-Straße 15  
12489 Berlin



# PROGRAMM:

Optische Verfahren stehen heute im Fokus der Entwicklung von neuen Applikationen in der Dünnschicht- und der Prozessmesstechnik. Die vielfältige spektrale Information, hohe Empfindlichkeit für ultradünne Schichten, on-line- und in-situ-Messfähigkeit unter industriellen Bedingungen, geringe Kosten und Wartungsaufwand machen optische Verfahren für die Analytik von dünnen Schichten und Überwachung von Prozessen besonders attraktiv. Der Schwerpunkt OPMT widmet sich in zwei aufeinanderfolgenden Fokuseminaren der Dünnschichtmesstechnik (31.03.09) und der in-situ-Messtechnik (12.05.09).

Im Fokuseminar Dünnschichtmesstechnik stehen Optische Messtechnik und Anwendungen von Firmen und Forschungseinrichtungen der Berlin-Brandenburger Region im Zentrum: von Biofilmen über photovoltaische Systeme bis zu technischen Beschichtungen.

## **Sprecher:**

Prof. Dr. Norbert Esser  
ISAS Institute for Analytical Sciences Department Berlin

Prof. Dr. Ulrich Panne  
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)  
Fachgruppe VI.4 Oberflächentechnologien

## **Organisation und Kontakt:**

Dr. Weidner, OpTecBB,  
Telefon: 030 / 6392 1720  
E-Mail: optecbb@optecbb.de

- 09:30 Uhr Qualitätssicherung für die Dünnschichttechnik mit optischen Verfahren**  
Uwe Beck, Andreas Hertwig, BAM
- 10:00 Uhr Anwendung der Dünnschichtmesstechnik in der Photovoltaik**  
Bernd Gruska, Sentech Instruments GmbH
- 10:20 Uhr Infrarotellipsometrie zur Strukturanalyse dünner Filme**  
Karsten Hinrichs, ISAS Department Berlin
- 10:40 Uhr Real-Time Film Thickness Monitoring of CIGS and CdTe Thin-Film Solar Cell Processes**  
Steffen Uredat, LayTec GmbH
- 11:00 Uhr III-Nitride optical properties in the thin film domain**  
Christoph Cobet, ISAS Department Berlin
- 11:20 Uhr Optical absorption of Si and SiGe thin films measured by photothermal deflection spectroscopy**  
Moshe Weizman, HZB
- 11:40 Uhr Messung von Lacken in der Automobilindustrie in Bezug auf die Farbe und Dicke**  
Martin Senft, X-Rite Optronik GmbH
- 12:00 Uhr Optical Characterization of Thin Film Silicon Solar Cells**  
Florian Ruske, HZB
- 12:20 – 13:20 Uhr Mittagspause**
- 13:20 Uhr Lumineszenzmessungen (PL und CL) an Halbleiternanostrukturen**  
Carsten Netzel, FBH Berlin
- 13:40 Uhr Rapid-XRF-Messverfahren für die Prozesskontrolle bei der Herstellung von Dünnschichtso-larzellen**  
Aniouar Bjeoumikhov, IfG GmbH
- 14:00 Uhr Referenzprobenfreie Röntgenspektrometrie für die Oberflächenkontaminationskontrolle und Dünnschichtcharakterisierung**  
Burkhard Beckhoff, PTB, Institut Berlin
- 14:20 Uhr Speziation vergrabener Nanoschichten durch Röntgenabsorptionsspektrometrie unter streifendem Einfall**  
Beatrix Pollakowski, PTB, Institut Berlin
- 14:40 Uhr Dünne Schichten für optische Komponenten - Anwendungen - Anforderungen - Prozesse**  
Beate Baumgarten, Berliner Glas KGaA
- 15:00 Uhr Kaffeepause und abschließende Diskussion**